

(19)  
(12)

(KR)  
(A)

(51) 。 Int. Cl.7  
H05B 33/10

(11)  
(43)

2003-0076376  
2003 09 26

(21) 10-2003-0017084  
(22) 2003 03 19

(30) JP-P-2002-00078326 2002 03 20 (JP)  
JP-P-2002-00078427 2002 03 20 (JP)  
JP-P-2003-00012381 2003 01 21 (JP)

(71) 가 가 2 5 5

(72) 8-41-7

2-76-2

가 가 556-1202

가 가 가 23-10

(74)

:

(54) E L , E L

, EL , EL

1

, , , , ,

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

< >

10, 40 : TFT

30 :

34 :

40a :

40b :

40c :

50 :

54 :

58 :

EL( )

, (LCD) , EL , EL

EL , EL , LCD 가 , LCD 가 ,  
 , , ,  
 , LCD , 2 TFT , (TFT) 11 , (TFT) , EL EL  
 EL  
 S , p , 1 TFT(10) SL CS가 n 1 TFT(10) 가  
 CV VL , 2 TFT(40) EL EL , DL , 1 TFT(10) C  
 , EL EL 2 TFT(40) 가  
 , GL H 1 TFT(10)가 ( ) DL 가 CS  
 2 TFT(40) EL EL 가 2 TFT(40) 가 ,  
 , 1 TFT(10)가 DL , 가 ,  
 , DL EL EL 가 , CS가 , 2 TFT(40)가 EL  
 , 가  
 가, EL , 1 TFT(10) 2 TFT(40) 가 . TFT  
 , 가 , 가 , 가 , EL 1  
 , , 가 ,  
 , EL 가 ,  
 , , LCD 가 , YAG  
 , 2 TFT(40)  
 가 TO , YAG , EL , TFT가 , TFT I  
 , TFT  
 , YAG TFT , 가  
 , 가 ,  
 EL 가 , 가







( , 1064nm) (6) , ,  
 , 가 (58) 가 ,  
 EL EL 가 , 가 .  
 가 , .  
 (100) , 8 , 1 EL EL (visu  
 al)  
 , 9 , (100) ,  
 (111) , (100)  
 (100) , (111) ,  
 (112) , (50) (58) , 가  
 , (100)  
 EL EL 가 , (58) , (100)  
 , 가 (2), (3) (4)  
 111) , YAG ( 355nm) ( (111) ( (111)  
 100) 5μm 10μm 5μm×5μm , (100) 0.3μm 10μm .  
 (100) 가 3μm , 10 (100)  
 4 ( (i) (iv) ,  
 (100) .  
 가 , 532nm , EL  
 가 , 355nm 308nm , 가  
 「 」  
 , , , EL  
 , EL  
 EL EL  
 7 VL , EL EL , EL EL 1 TFT(  
 10) , EL EL  
 EL , EL 가 . EL , EL  
 , EL 가가 EL ,  
 , , ( ) 가 .  
 , EL , EL , EL  
 , 가 .



7.  
EL

EL

7 8.

7 9.  
EL

7 EL

10. EL 가 EL

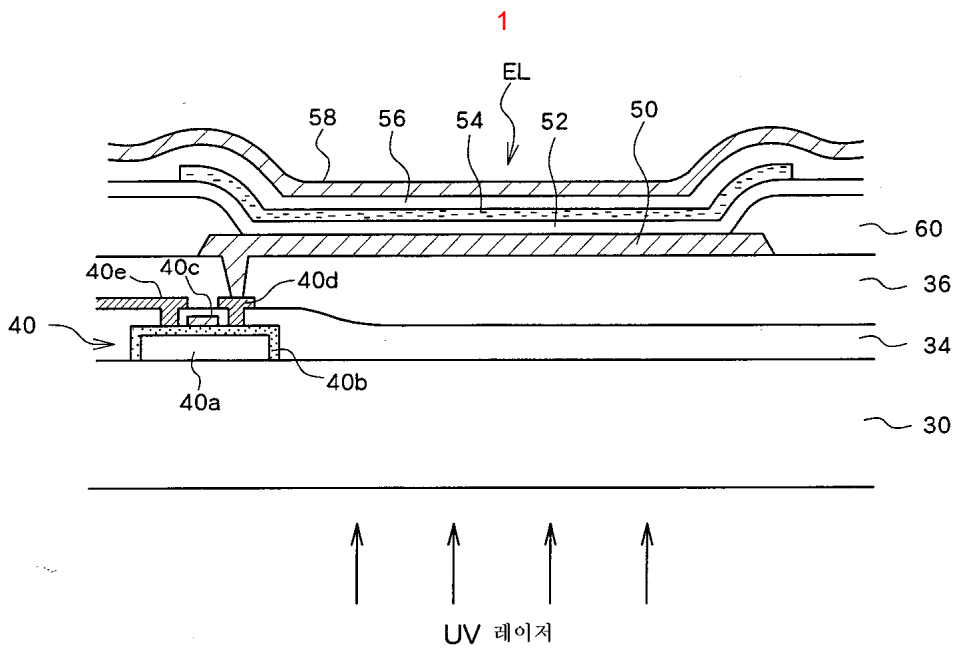
EL

EL

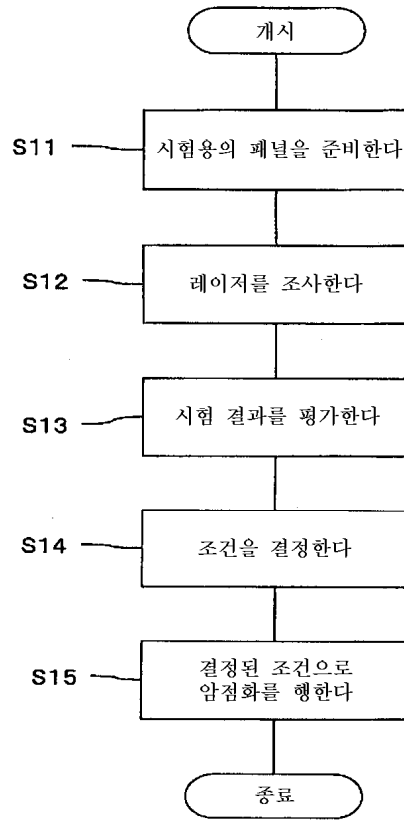
10 11.

10 12.

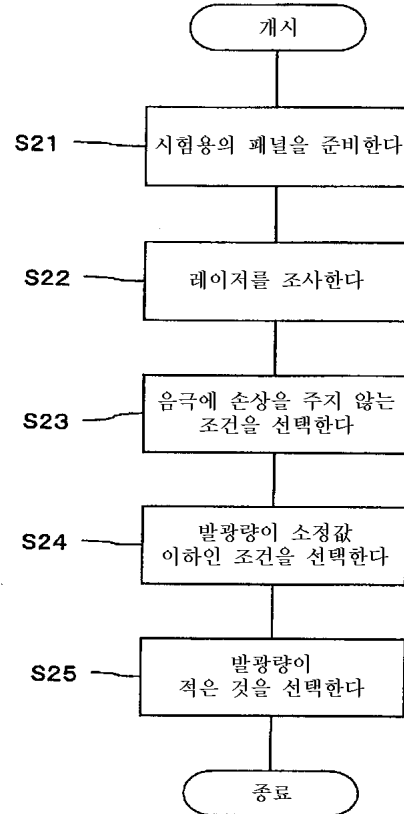
532nm

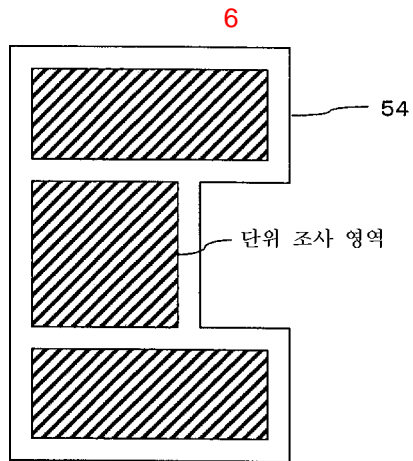
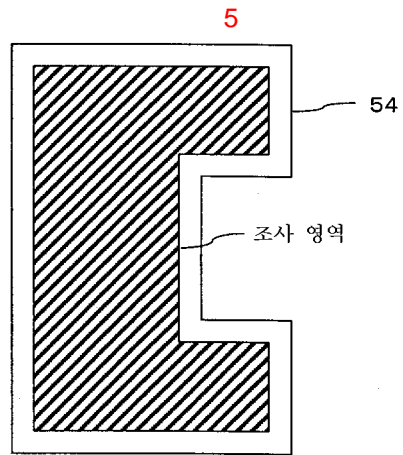
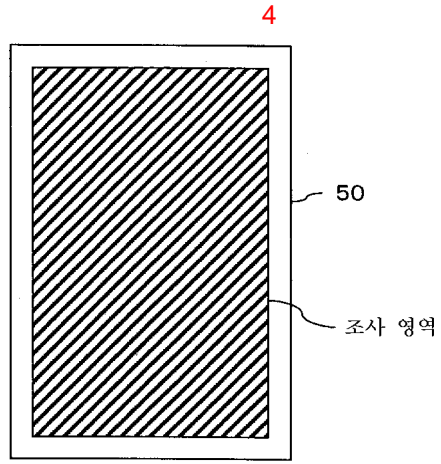


2

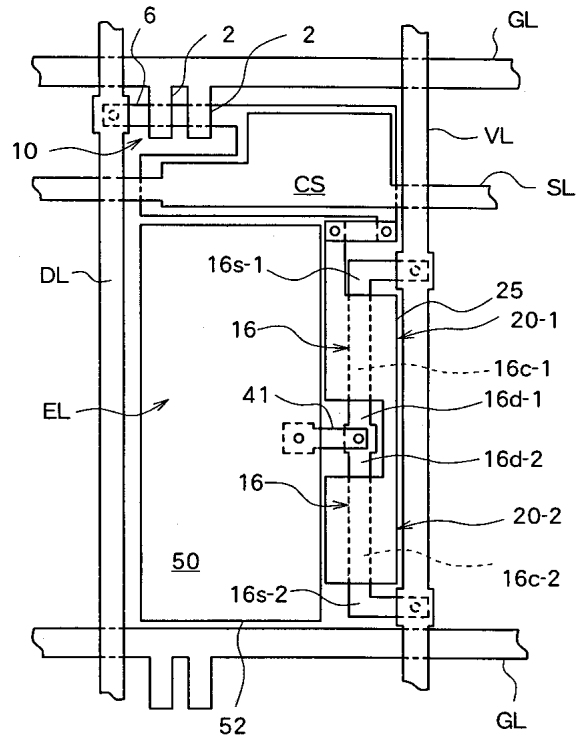


3

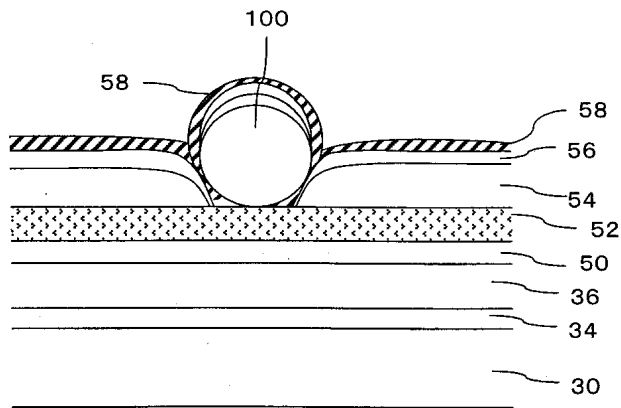




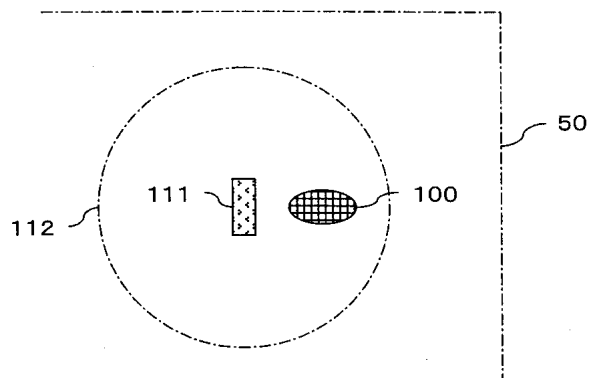
7

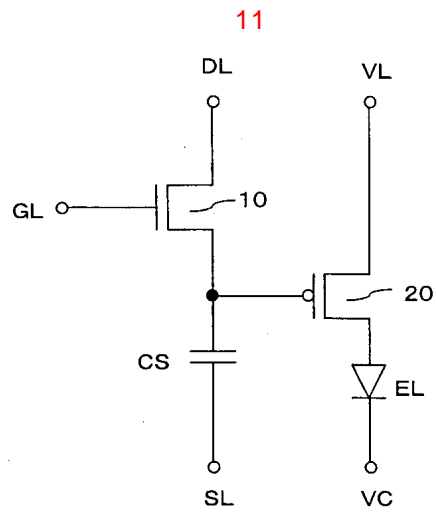
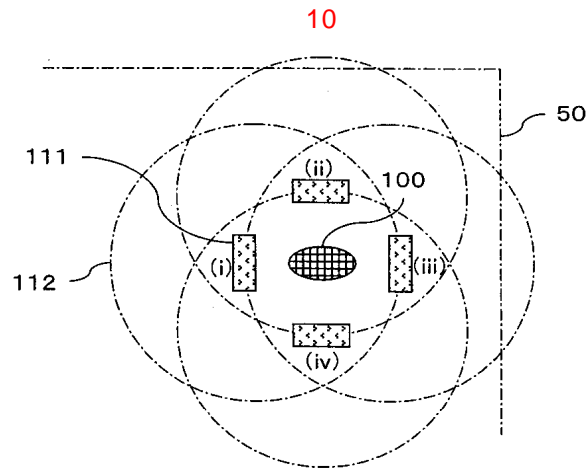


8



9





专利名称(译)	使有机EL面板的缺陷像素敏感的方法，有机EL面板及其激光加工方法		
公开(公告)号	<a href="#">KR1020030076376A</a>	公开(公告)日	2003-09-26
申请号	KR1020030017084	申请日	2003-03-19
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社 山洋电气株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
当前申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
[标]发明人	NISHIKAWA RYUJI 니시카와류지 JINNO YUSHI 진노유시 OGAWA TAKASHI 오가와다카시 NAGATA RYOZO 나가따료조		
发明人	니시카와류지 진노유시 오가와다카시 나가따료조		
IPC分类号	H05B33/10 H01L51/56 G09G3/00 H01L27/32		
CPC分类号	H01L2251/568 H01L27/3244 G09G3/006 Y10S428/917		
代理人(译)	LEE, JUNG HEE CHU, 晟敏		
优先权	2002078326 2002-03-20 JP 2002078427 2002-03-20 JP 2003012381 2003-01-21 JP		
其他公开文献	KR100500062B1		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

激光选择性地照射到像素的有机EL元件。结果，有机EL元件的有机层的功能劣化，并且发光功能丧失。在该方法中，阴极没有损坏。1 指数方面 激光照射，有机层，缺陷像素，臂点火，阴极，发光区域

